

## 日本ゼオン、新規エーテル系溶剤製造設備の新設及び販売の開始

2005年10月19日

日本ゼオン（社長 古河直純）は新規エーテル系溶剤「シクロペンチルメチルエーテル」（以下CPME）を開発し市場評価をおこなっていたが、良好な評価結果得たことより水島工場内に年産約1,000トンの設備を新設し、本年11月から本格販売を開始する。

なお、設備投資額は約4億円。


CPMEは、従来エーテル系溶剤に比較して(1)水に溶解しにくい (2)危険な過酸化物が生成しにくいという特長をもち、環境負荷の低減やコスト削減をはかることができる。

具体的には

- (1) 水に溶解しにくいので、水との分離・水からの回収が容易で廃液量や廃水量を削減できる。
- (2) 過酸化物が生成しにくいので、蒸留回収が容易である。
- (3) CPMEは化学プロセスである反応・抽出・晶析の3工程すべてで溶剤として使用することが可能である。また、1つの反応釜で上記3工程を連続的に運転し、目的物の製造が可能となるため、運転費用、設備費の両面より大幅なコストダウンが期待できる。

使用用途としては、医薬品や電子材料の化学プロセス用溶剤であるが、従来のエーテル系溶剤であるテトラヒドロフラン(THF)、ジエチルエーテル(エーテル)及びメチル t-ブチルエーテル(MTBE)などの代替溶剤として使用することができる。

なお、本研究開発の一部は、(独)新エネルギー・産業技術開発機構から委託を受けた「次世代化学プロセス技術開発」により実施されたものである。

 本件に関するお問い合わせ

日本ゼオン株式会社 CSR統括部門 広報室  
Tel : 03-3216-2747

[▶ お問い合わせフォーム](#)

---

© ZEON CORPORATION. All rights reserved.